

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 2 区分
 【発行日】平成 19 年 12 月 20 日 (2007.12.20)

【公表番号】特表 2003-514877(P2003-514877A)
 【公表日】平成 15 年 4 月 22 日 (2003.4.22)
 【出願番号】特願 2001-539595(P2001-539595)
 【国際特許分類】

C 0 7 C 67/313 (2006.01)
B 0 1 J 31/40 (2006.01)
B 0 1 J 38/00 (2006.01)
C 0 7 C 67/58 (2006.01)
C 0 7 C 69/716 (2006.01)
 C 0 7 B 61/00 (2006.01)

【F I】

C 0 7 C 67/313
 B 0 1 J 31/40 Z
 B 0 1 J 38/00 3 0 1 R
 C 0 7 C 67/58
 C 0 7 C 69/716 Z
 C 0 7 B 61/00 3 0 0

【手続補正書】
 【提出日】平成 19 年 10 月 26 日 (2007.10.26)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】請求項 9
 【補正方法】変更
 【補正の内容】

【請求項 9】ロジウム / フォスファイトリガンド複合体及び遊離の二座配位子フォスファイトリガンドを、高沸点のハイドロホルミル化合物をも含有するハイドロホルミル化混合物から、該混合物を重合体膜に接触させることにより分離する方法において、該ハイドロホルミル化混合物が、3 - ペンテン酸アルキル及び / 又は 4 - ペンテン酸アルキルを、ロジウム / 二座配位子フォスファイトリガンド複合体触媒を用いて一酸化炭素及び水素と反応させることにより 5 - ホルミル吉草酸アルキルを製造するためのハイドロホルミル化プロセスから誘導されたものであり、吉草酸アルキル又は吉草酸アルキルと 1 種以上のペンテン酸アルキル化合物を含む混合物を用いて、該混合物中の高沸点化合物の量が 50 重量 % (混合物全量に対して) であり且つ $x \pm 200$ (ここで x は膜のカットオフ (g / モル) である) の分子量の化合物の量が 20 重量 % (混合物全量に対して) である程度に、該混合物が希釈されるところの方法。